

附件1：薄膜晶体管液晶显示器件生产企业进口物资清单

(1) 薄膜晶体管液晶显示器件生产企业进口生产性原材料清单

序号	类别		商品名称	英文名称 (供参考)	税则号列 (供参考)	性能指标
1	玻璃	玻璃/玻璃纤维/ 液晶屏	玻璃微粒/有机硅醇盐微粒/边框胶纤维	Glass Fiber	70182000/70199090	glass fiber的粒径为3 μ m~5 μ m
2			低温多晶硅用玻璃基板	LTPS Glass	70060000	应变点 \geq 670 $^{\circ}$ C, 热膨胀系数 \leq 39 \times 10 $^{-7}$ / $^{\circ}$ C
3			金属氧化物用玻璃基板	IGZO Glass	70060000	制程温度 \geq 350度以上, 背面粗糙度 \geq 0.4纳米
4			盖板玻璃(强化玻璃)	Strengthen Glass	70060000	以下条件同时满足: 1. 强度 \geq 770Mpa 2. 强化深度 \geq 75 μ m
5	彩膜	彩膜	彩色滤光膜/彩色滤光片	Color Filter	90019090/70200011	仅用于1100mm*1300mm, 上述长和宽指标须同时满足, 且满足以下条件之一即可: 1. 宽视角(高级超维场转换ADS/平面内开关IPS/边场效应开关FFS)型 2. 扭曲向列(TN)型中用于10.1寸以下(含10.1寸) 3. PPI \geq 400
6			光阻/光阻剂/光刻胶(红, 绿, 蓝, 光刻间隔膜, 平坦层)	Color Resist/Photo Resist (R, G, B, PS, OVER COAT, BCS, BPS, PAC)	32041700/37070000/ 37071000	
7	模具	模具	光罩/掩模版(掩膜板/掩膜版)	Photo Mask	37059090/90029090/ 84805000/84807190	满足以下条件之一即可: 1. LTPS Array MASK(低温多晶硅阵列掩模版): CD \leq 0.15 μ m, registration \leq 0.3 μ m, total pitch \leq 0.5 μ m, minL/S:2.0 μ m 2. LTPS CF MASK(低温多晶硅彩膜掩模版): CD \leq 0.25 μ m, registration: \leq 0.5 μ m, total pitch \leq 0.5 μ m 3. Array/CF 10.5代线及以上(含10.5代线) MASK 4. 使用下述其中一种技术的所有尺寸MASK(GT MASK/Half tone/Gray tone/UV2A/SSM/Binary/Short Channel Mask/PSM)

序号	类别		商品名称	英文名称 (供参考)	税则号列 (供参考)	性能指标
8	胶膜	丙烯酸树脂类膜	偏光片	Polarizer	90012000	满足以下条件之一即可： 1. 偏光片单体厚度 $\leq 90\mu\text{m}$ （单体厚度不包括保护膜、离型膜、扩散胶层、增亮膜的厚度） 2. 耐热温度大于等于95摄氏度，同时耐低温度小于等于-40摄氏度 3. 黄光589nm透过率 $\leq 20\%$
9			各向异性导电芯片/各向异性导电膜/自粘塑料膜/各向异性导电胶片/各向异性导电晶片	ACF	40059100/40059900/ 38249099	
10			层间绝缘膜/保护膜	Organic Insulator/Over Coat	39209990/39202090/ 39069090/39206200	
11	表面取向剂	聚酰亚胺	聚酰亚胺取向液/聚亚酰胺酸取向液/聚酰胺酸溶液/聚酰胺酸取向液/聚酰亚胺	Polyimide For Alignment Film	39119000/38249099/ 32089090	
12	靶材	靶材	靶材（钛，铜）/ 旋转靶（铝，钛，钼，铜，硅）	TARGET (Ti, Cu) / TARGET (Al, Ti, Mo, Cu, Si)	76081000/74071090/ 81029900/76169990/ 84869091	
13			靶材（铝钨，钼钨，氧化钨锡，钼铌，钼钛，钨锌氧化物，钨镓锌氧化物）/ 旋转靶（铝钨，钼钨，氧化钨锡，钼铌，钼钛，钨锌氧化物，钨镓锌氧化物，氧化铌）	TARGET (Al-Nd, Mo-Nd, ITO, Mo-Nb, Mo-Ti, IZO, IGZO) / TARGET (Al-Nd, Mo-Nd, ITO, Mo-Nb, Mo-Ti, IZO, IGZO, NbOx)	76169990/81129930/ 79070090	
14	树脂	树脂类	硅球/导电金球/导电晶球	MICRO SPHERICAL PLASTIC BEADS/Silica Beads/ElectricBeads/Silica Ball/Au Ball/Aub Ball	71159010/70182000	
15			隔热物/垫料	SPACER	39269090/39269010/ 38249099/39039000/ 39059900	
16			边框胶/封框胶(环氧树脂)/密封胶/封口材料	Sealant	35061000/35069120/ 32141090	
17			紫外线固化树脂/防湿绝缘胶/防湿绝缘液/防湿绝缘涂料	Ultraviolet curing resin/UV Tuffly/Tuffly	39191010/38249099/ 35061000/35069900/ 32141010	

序号	类别		商品名称	英文名称 (供参考)	税则号列 (供参考)	性能指标
18	树脂	树脂类	硅树脂/硅胶/矽胶	SILICON RESIN	39100000/35069190	
19			光学绝缘树脂/光学弹性树脂	Over Coat (Insulate/Passivation of TP)/SVR	39073000/35069900	
20			触摸屏用光学胶	Optical Clear Adhesive(OCA)/ Liquid Optical Clear Adhesive (LOCA)	39199090	
21			非感光型有机绝缘树脂	PTS	39073000	
22		导电树脂	转印银浆/银环氧胶/芳基酸与芳基胺聚合物(银胶)/转印电极材料/银胶/Ag环氧胶	AG Paste / Ag Epoxy	38249099	
23	高纯气体	高纯度混合气体/高纯度成膜气体/其他高纯度特殊气体	硅烷	Gas (SiH ₄)	28500090	SiH ₄ 纯度≥99.999% N ₂ 含量≤0.5ppmv H ₂ 含量≤20ppmv O ₂ 含量≤0.06ppmv
24			磷烷/磷烷混氢/20%磷烷氢混合气/1%磷烷氢混合气	Gas (PH ₃)/Gas (PH ₃ /H ₂)/Gas (20%PH ₃ /H ₂)/Gas (1%PH ₃ /H ₂)	28500090/28480000	磷烷纯度≥99.9995%; 氢气纯度≥99.9999%
25			1%磷化氢-硅烷混合气	Gas (1%PH ₃ /SiH ₄)	38249099	
26			三氯化硼	Gas (BCl ₃)	28121049/28273990	三氯化硼纯度≥99.999% Ca≤50ppbv; K≤50ppbv; Mg≤10ppbv; Na≤50ppbv
27			氙气/高纯氙	Gas (Xe)	28042900	H ₂ O≤0.5ppmv
28			0.4%氙氖混合气	0.4%Xe/Ne	38249099/28042900	
29			1%氟氖混合气	1%F ₂ /Ne	38249099/28042900	
30			乙硼烷氢混合气(乙硼烷)	Gas (B ₂ H ₆ /H ₂)	28500090	
31			激光退火用混合气体/含氢氟激光退火用混合气体	H ₂ +Ne/H ₂ inNe	28042900/28261990	纯度≥99.999% H ₂ O≤3ppmv
32			正硅酸乙酯	Liquid (TEOS)	29209090	纯度≥99.999999%

序号	类别		商品名称	英文名称 (供参考)	税则号列 (供参考)	性能指标
33	高纯气体	高纯度混合气体/ 高纯度成膜气体/ 其他高纯度特殊气体	氯化氢/氩氦混合气	Gas (4.5%HCl/0.9%H ₂ /94.6%Ne)	38249099	
34			氢气/氩气混合气体	Gas (3%H ₂ /Ar)	28042900	
35			氦气	He	28042900	氦气纯度≥99.999%
36			四氟化硅	SiF ₄	28129019	纯度≥99.998%;CO ₂ 含量≤1ppmv;CO含量≤0.5ppmv;HF含量≤5ppmv;P、B、As含量≤0.5ppmv
37			含氢和氯化氢的氖	4.5%HCl in Ne	28042900	
38		高纯度刻蚀气体	三氟化硼/三氟化硼同位素	11BF ₃	28129019/28459000	B-11 (%) ≥99.7% O ₂ /Ar、SO ₂ 、CO ₂ 、N ₂ 、HF、SiF ₄ 杂质≤25ppmv
39	刻蚀液	刻蚀液	二氧化硅蚀刻液/缓冲氧化层刻蚀液	BHF	28261910/28111100	
40	光刻工艺 用化学品	显影液/光刻胶/ 去胶液/增粘剂/ 稀释剂/静电防 止剂	乙酸丁脂/稀释剂/醋酸丁脂	THINNER	29153300/38140000	同时满足以下条件: 1. Particle ≥0.5 μm: <100 (pcs/ml) 2. PGMEA: 99.8%
41			光刻胶	PHOTO RESIST	37071000	同时满足以下条件: 1. taper角>65° 2. CD≤1.5 μm
42			稀释剂	Thinner	38140000	同时满足以下条件: 1. PGMEA: >99.8% 2. Particle >0.5 μm: <50 (pcs/ml)
43	化学洗剂	玻璃基板洗剂/ PI洗剂/液晶洗 剂	PI前清洗剂/硅烷液	CLEANER (PI&ASS'Y)	29225090	仅用于铜工艺,且同时满足以下条件: 1. pH: 5.5~7.5 2. 电导度: 0.15 (MAX)
44			转印凸版 (APR版) 清洗剂/R丁内脂/APR版清洗剂	CLEANER for APR PLATE	38101000/29322090	
45			剥离剂/剥离液	PI/PR stripper	38101000	仅用于铜工艺,且同时满足以下条件: 1. pH: 12.5~13.5 2. Particle >0.5 μm: <100 (pcs/ml)
46			Cu剥离液补充浓缩液	Inter, NMF	38249999	
47		化学洗剂	高分子导电液	PEDOT	38249999	
48	模组	模组	多元件集成电路	Multi-component Integrated circuit	85423111/85423119/ 85423210/85423310/ 85423910	同时满足以下条件: 1. 工艺制程≤40nm 2. IC刷新率120HZ 3. 包含两个或两个以上单片